

先端研究施設共用促進事業
利用成果報告書

無償トライアル利用

課題番号：100224-02

利用課題名：めっき表面上のシリコン有無の確認

利用者名：(株) 生方製作所

利用施設： 名古屋工業大学 大型設備基盤センター

利用期間： 平成 22 年 2 月 24 日～平成 22 年 3 月 12 日

背景と利用目的：

めっきの工程前後での表面状態をオージェ電子分光装置を用いて比較を行なう。

実験・解析方法：

オージェ電子分光装置 (JEOL JAMP-7800) を用いて、表面から放出されるオージェ電子のスペクトル測定を行なった。

成果の概要：

工程前後ともに、めっき表面の極薄領域においてのみ、二酸化ケイ素 (SiO₂) が付着していることが確認された。

社会、経済への波及効果の見通し：

なし

論文発表状況・特許出願：

なし

参考文献：

なし

利用成果の公表：

可

成果公開延期の希望の有無：

なし